

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成20年4月24日 (2008.4.24)

【公表番号】特表2007-529579(P2007-529579A)

【公表日】平成19年10月25日 (2007.10.25)

【年通号数】公開・登録公報2007-041

【出願番号】特願2007-503232(P2007-503232)

【国際特許分類】

C 0 8 G 18/79 (2006.01)

C 0 8 G 18/67 (2006.01)

C 0 8 G 18/16 (2006.01)

C 0 8 G 18/66 (2006.01)

C 0 8 F 290/06 (2006.01)

C 0 9 D 7/12 (2006.01)

C 0 9 D 175/14 (2006.01)

C 0 9 D 4/00 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 G 18/79 A

C 0 8 G 18/67

C 0 8 G 18/16

C 0 8 G 18/66

C 0 8 F 290/06

C 0 9 D 7/12

C 0 9 D 175/14

C 0 9 D 4/00

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月4日 (2008.3.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を含み、任意にイソシアネート反応性基を含んでよい、アロファネート基含有バインダーの製造方法であって、

A) まず、1 種以上のウレトジオン基含有イソシアネート官能性化合物を、

B) 化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を含み、イソシアネート反応性基を含む、1 種以上の化合物と反応させ、次いで、

C) 成分 B) 以外の 1 種以上のヒドロキシル基含有化合物（これら化合物の少なくとも 1 つは 2 以上のヒドロキシル官能価を有する。）と、

D) 触媒としての 1 種以上のフェノキシド基含有化合物、並びに

E) 任意に助剤及び添加剤の存在下、反応させ、

成分 C) の化合物との反応が少なくとも部分的にアロファネート基の形成を伴って進行する方法。

【請求項 2】

成分 A) のウレトジオン基含有化合物がヘキサメチレンジイソシアネートに基づくこと

を特徴とする、請求項 1 に記載のアロファネート基含有バインダーの製造方法。

【請求項 3】

成分 B) に、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、4-ヒドロキシブチルアクリレート、ポリエチレンオキシドモノ(メタ)アクリレート、ポリプロピレンオキシドモノ(メタ)アクリレート、及び/又はアクリル酸とグリシジルメタクリレートとの反応生成物を使用することを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載のアロファネート基含有バインダーの製造方法。

【請求項 4】

成分 C) に、単量体のジオール及びトリオール、それら由来のポリエーテル、並びに 1,000 g/mol 未満の平均分子量  $M_n$  を有するポリラクトンからなる群から選ばれる 1 種以上の化合物を使用することを特徴とする、請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載のアロファネート基含有バインダーの製造方法。

【請求項 5】

成分 D) に、触媒として、テトラブチルアンモニウム 4-(メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチルアンモニウム 2-(メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチルアンモニウム 4-ホルミルフェノキシド、テトラブチルアンモニウム 4-ニトリルフェノキシド、テトラブチルホスホニウム 4-(メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチルホスホニウム 2-(メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチルホスホニウム 4-ホルミルフェノキシド、テトラブチルアンモニウムサリチレート及び/又はテトラブチルホスホニウムサリチレートを使用することを特徴とする、請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載のアロファネート基含有バインダーの製造方法。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の方法によって得られる、化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を含むアロファネート基含有バインダー。

【請求項 7】

- a) 1 種以上の請求項 6 に記載のアロファネート基含有バインダー、
  - b) 任意に、1 種以上の、化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を任意に含んでよい、遊離イソシアネート基又はブロックトイソシアネート基含有ポリイソシアネート、
  - c) 任意に、成分 a) の化合物とは異なり、化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を含み、任意にイソシアネート反応性基を含んでよい、他の化合物、
  - d) 任意に、1 種以上の、化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を含まない、活性水素含有イソシアネート反応性化合物、
  - e) 開始剤、
  - f) 任意に助剤及び添加剤
- を含んでなる被覆組成物。

【請求項 8】

請求項 6 に記載のアロファネート基含有バインダーから得られた被覆剤で被覆された基材。